

<第35回フォトポリマー講習会>

日時:2025年8月28日(木)・29日(金) 9時15分～17時20分

会場:オンライン開催(Zoom)

協賛:(社)日本化学会

[参加費]

会員:18,000円(4名以上参加の場合は一律65,000円/会員企業)

日本化学会会員:18,000円

非会員:28,000円、学生 8,000円

[参加申込]

当会ホームページ(<http://www.tapi.jp>)のメールフォームからお申し込み下さい。

受付後、事務局より参加方法についてご連絡いたします。

※テキストはメールフォームによる申し込み者にのみPDF配信いたします。

[締め切り]

2025年8月14日(木)

プログラム

[基礎編](8月28日(木)第1日目)

09:15～09:20	会長挨拶	大阪公立大学	堀邊 英夫
09:20～10:30	「光化学の基礎と分子デザイン」	成蹊大学	稲垣 昭子 氏
10:40～11:50	「光反応中間体と観測」	神奈川大学	河合 明雄 氏
13:00～14:10	「ポリマーの光化学と特性」	大阪公立大学	岡村 晴之 氏
14:20～15:30	「リソグラフィの基礎とフォトレジストの材料設計」	Eリソサーチ	遠藤 政孝 氏
15:40～16:50	「フォトポリマーの特性評価」	リソテックジャパン(株)	関口 淳 氏
16:50～17:20	第1日目の総括討議 / 講師ごとのブレイクアウトルーム		

[応用編](8月29日(金)第2日目)

09:20～10:30	「レジストの分析」	東レリサーチセンター	小北 哲也 氏
10:40～11:50	「光酸発生剤の基礎と先端材料への応用」	富士フイルム(株)	土村 智孝 氏
13:00～14:10	「感光性耐熱材料の開発と事業化」	三井化学(株)	表 利彦 氏
14:20～15:30	「微細加工用レジスト」	兵庫県立大学	渡邊 健夫 氏
15:40～16:50	「トピックス 積層型CMOSイメージセンサー」	ソニーセミコンダクタソリューションズ(株)	梅林 拓 氏
16:50～17:20	第2日目の総括討議 / 講師ごとのブレイクアウトルーム		